

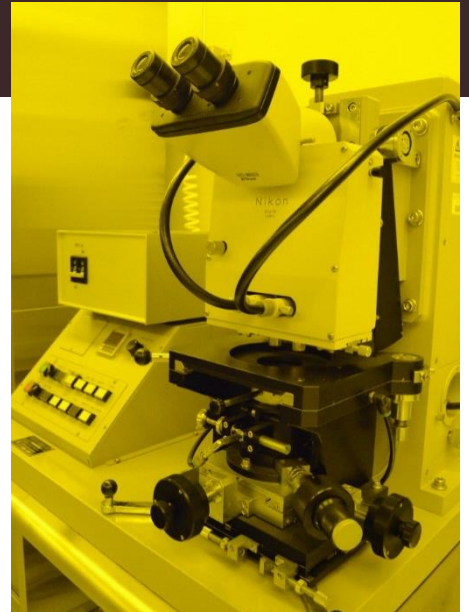
# 加工 (フォトリソ装置群)

## 片面マスクアライナ装置

ミカサ社製 MA-10型

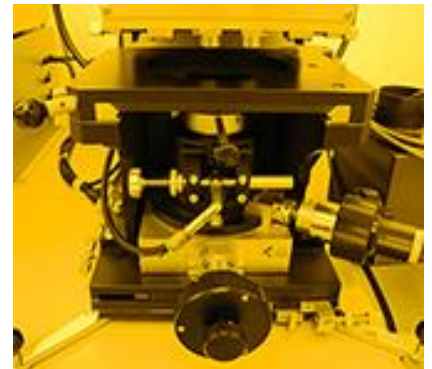
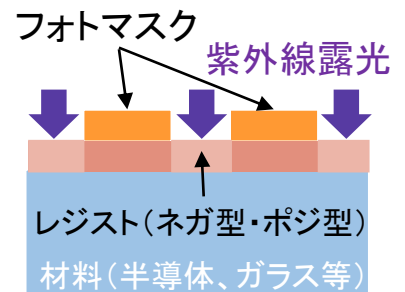
### 仕様

- マスクサイズ 2.5~5インチ
- ウェハサイズ 10mm ~ 80mm
- 顕微鏡 双眼実体顕微鏡 30倍
- 試料台移動範囲 前後左右 ±5mm、上下 3mm  
回転、70度
- 露光用光源装置 250W超高压水銀灯



### 高精度位置合わせ

マスクアライナは、フォトリソグラフィを行うための露光装置です。本装置では、マスクを用いた密着露光方式で、選択的にレジストに紫外光を当てることができます。また、試料位置に対するマスク位置を正確に位置決めするための顕微鏡光学系と微動機構を備えています。



「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業」

微細加工プラットフォーム ・ 香川大学



香川大学 産学連携・知的財産センター  
ナノテクノロジー支援室

TEL/FAX:087-887-1873

E-mail: nanoplatform-c@kagawa-u.ac.jp